P9. 2003-190781

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number : 2003-19078)

(43) Date of publication of application: 08.07.2003

(51) Int. CI. 8013 20/10 8010 37/02 8013 20/28 C018 33/14

C12H 1/94

(21) Application number: 2001-398397 (71) Applicant: MITSUBISHI CHEMICALS CORP

(22) Date of filing : 27.12.2001 (72) Inventor : MORI HIROSHI

KATOU HANAKO

(64) SILICA GEL FOR FILTER AID

(87) Abstract: PROBLEM TO BE SOLVED: To realize restriction of deterioration with age, improvement of productivity, and PROBLEM TO BE SOLVED: To realize restriction of deterioration with age, improvement of productivity, and more selective and efficient adsorption of unnecessary substances in a silica gel for filter aid.

SOLUTION: The silica gel for filter aid which is used for removing the unnecessary substances together with the silica gel itself by filtration after the unnecessary substances in the materials to be filtered is adsorbed by bringing the silica gel for filter aid into contact with the materials to be filtered has (a) the pore volume of 0.6-2.0 ml/g, the specific surface area of 300-1.000 m2/g, (c) a most likelihood diameter (Dmax) of the pore of 20 nm or less, (d) the total volume of the pore of the diameter of a range of Dmax ±20% being 50% or more of the total volume of the total pores. (e) it being noncrystalline. (f) the total content of metal impurities of 500 ppm or less, and (g) when the chemical shift of Q4 peak in a solid Si-NMR is expressed in terms of 8 (ppm), 8 is satisfied by the following formula: -0.0705× (max)-110 36>8 (f) (Dmax)-110.36>8 (1).

LEGAL STATUS [Date of request for examination]
[Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application] [Patent number] [Date of registration] [Number of appeal against examiner's decision of rejection] Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection. [Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特新出版公開番号 特開2003-190781 (P2003-190781A)

(43)公開日 平成15年7月8日(2003.7.8)

(51) Int.CL ⁷	发 列起号	FI - 5-73-1*(***
B01J 20/10		B011 20/10 D 4B028
B01D 37/02		B01D 37/02 G 4D086
B01J 29/28		B01J 20/28 Z 4G066
C018 33/14		C01B 33/14 4G072
C12H 1/04		C12H 1/04
		審査網束 未網求 請求項の数6 OL (全 II
(21)組織等行	特賞2001 398397(P2001 398397)	(71)出職人 000005968 三賽化学株式会社
(22) 計算日	平成13年12月27日(2001, 12, 27)	東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号
		(72)発明者 森 繁
		福岡東北九州市八幡四区黒崎城石1番
		三菱化学株式会社均
		(72)発明者 加藤 被条子
		福岡與北九州市八幡西区黑崎城石1番
		三菱化学株式会批内
		(74) 代理人 100092978
		弁理士 英田 有
		₩\$ #€

(54) [発明の名称] 渡邉助剤用シリカゲル

(57) 【要約】

【課題】 濾過助剤用シリカゲルにおいて、経時劣化の 抑制、生産性の向上。より選択的且つ効率的な不要物質 の吸着を実現できるようにする。

【解決手段】 被濾過物に接触させ該被濾過物中の不要 物質を吸着させた後、該不要物質と一体に該被濾過物か ら濾過により除去される、濾過的剤用シリカゲルであっ て、(a) 細孔容積が0.6~2.0ml/gであり、

- (b) 比表面積が300~1000m2/gであり、
- (c) 細孔の最頻直径 (Dmax) が20 n m未満であり、(d) 直径がDmax ± 20%の範囲内にある細孔の総容積が全細孔の総容積の50%以上であり、(e) 非晶質であり、(i) 金麗不純物の総含有率が500 p p m以下であり。(g) 固体5 i NMRでのQ⁴ビークのケミカルシフトを6(p p m) とした場合、6が下記式(!) を満足するようにする。

-0.0705×(Dmax)-110.36>δ ・・・式(I)

[特許請求の範囲]

【請求項1】 被濾過物に接触させ該被濾過物中の不要 物質を吸着させた後、該不要物質と一体に該被濾過物か 6濾過により除去される、濾過助剤用シリカゲルであっ て、(a) 細孔容積が0、6~2、0m1/gであり、

- (b) 比表面積が300~1000m2/gであり。
- (c)細孔の最頻直径(Dmax)が20nm未満であ

College of the College Col

を満足することを特徴とする、濾過助剤用シリカゲル。 【請求項2】 該被濾過物として発酵飲料の濾過に使用 されることを特徴とする、請求項1記載の濾過助剤用シ リカゲル。

【請求項6】 シリコンアルコキシドを加水分解する工程を経て製造されることを特徴とする、請求項1~5の何れか一項に記載の議過助剤用シリカゲル。

[発明の詳細な説明]

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、被濾過物に接触させ被濾過物中の不要物質を吸着させた後、不要物質と一体に被濾過物から濾過により除去される、濾過助剤用シリカゲルに関する。

[0002]

【従来の技術】従来より、瀬類(ビール、焼酎、味醂、 滴酒、果実酒など)、発酵翻味料(醤油、食酢など)、 滴涼飲料類〔ジュース(果汁)、炭酸飲料など〕。食用油 類(ナタネ油、ゴマ油、コーン油など)、各種医薬用原 液、各種和濃薬抽出液などの被濾過物から、製造過程で 生じる不要物質(酒、みりん、ビール等の醸造物であれ ぱタンパク質や酵素コロイド状物質)を除去するのに濾 過助剤としてシリカゲルが使用されている。

【0003】異体的に説明すると、被漆過物に濾過助剤 用のシリカゲルを混入してからこれを濾材にフィードし たり、予め濾材に濾過助剤をブレコートして、この濾材 に上記被濾過物をフィードしたりすることにより、不要 物質はこの濾過助剤に吸着され濾過助剤と一体に上記被 濾過物から分離・除去される。また、濾過助剤により吸 着できないような比較的サイズの大きな不要物質は濾材 により分離・除去される。このように、比較的小さな不 要物質については濾過助剤と一体に濾過すればよいの で、濾過助剤を使用しない場合に較べ濾材の目を粗くす ることができ、濾過抵抗を減少させることができる。 り、(d) 直径がDmax±20%の範囲内にある細孔の 総容積が、全細孔の総容積の50%以上であり。(e) 非晶質であり、(f) 金属不純物の総含有率が500p pm以下であり、(g) 箇体Si-NMRでのQ⁴ピー クのケミカルシフトをδ(ppm)とした場合に、δが 下記式(I)

-0,0706×(D_{max})-110,36>8 ···式(1)

【0004】このような譲過助利用シリカゲルとしては、例えば特勝平8-173137号公報に、選度400~800℃で、10秒~10時間焼成されてなり、比表面積700~1000m²/g、網孔容積1、1~1.6m1/g、平均細孔径6~10nmの物性を有するビール安定化処理用シリカゲルが開示されている。また、特勝平9-25114号公報に、細孔径50~500Å(オングストローム)の範囲の細孔の容積が0、7~2、5m1/gの範囲であり、且つ細孔径が500Å(オングストローム)を越える細孔の容積が0、2~0、8m1/gの範囲であることを特徴とする濾過利用シリカゲルが開示されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、被濾過物が食品、特に発酵飲料(例えばピール)ような嗜好品では、極めて繊細な風味や蓄味や色度等の調整が要求されており、濾過助剤用シリカゲルでは、このような風味や香味や色度等に影響を与える各種成分を、より高額度に識別・選択して吸着することが強く望まれている。このような高精度の吸着性能の実現は、被濾過物から除去したい所望の成分のサイズに応じて、濾過助剤用シリカゲルの細孔径をどれだけ精度良く制御できるかにかかっている。しかしながら、上記公報では、このような点について何ら注目していない。

【0006】シリカゲルの銀孔を制度良く制御する方法としては、界面活性剤からなる有機テンプレートを使用して細孔を形成する方法があり、このような方法により細孔制御されたシリカゲルは一般にミセルテンプレートシリカと呼ばれる。ミセルテンプレート・シリカと呼ばれる。ミセルテンプレート(界面活性剤)の除去処理が行なわれるものの、界面活性剤自体、或いは界面活性剤に含まれる金属不純物が残留してしまうため、食品の濾過には使用できない。

【0007】また、このように不純物を多く含んだシリカゲルは耐熱性や耐水性が低い。さらには、界面活性剤を使用して製造されたシリカゲルは結晶構造を含むものとなり、水中熱安定性に乏しいものとなってしまう。なお、ここでいう結晶構造とは、X練四折パターンで6オングストローム(A: Units d-spacing)を越えた位置に少なくとも1つの結晶構造のピークとして示され検知されるものであり、同一径の細孔が規則的に配列している状態を指す。このような物質は細孔分布がシャープで

あるが細孔壁が薄く、物性変化が起きやすい。さらに、 有機テンプレートが高価なため製造コストが高いといっ た課題もある。

【0008】また、不要物質を吸着した濾過助剤用シリカゲルは、この不要物質を焼成等により除去され再び不要物質を吸着しうる状態に再生された後、再び使用され、このようなサイクルが繰り返されることがある。従来の水ガラスより製造されるシリカゲルは原料由来の不純物が相当量含まれており、特にアルカリ金属。アルカリ土類金属の不純物が含まれていると耐熱性や耐水性が低くなってしまう。またミセルテンブレートシリカを使用して製造したシリカゲルは、上述したように耐熱性や耐水性が低い。このため、従来の水ガラスより製造されるシリカゲルやミセルテンプレートシリカは上述したように再生処理を行なって繰り返し使用しようとしても早期に劣化してしまう。

【0009】また、コストの観点から、所定量の被濾過物の処理をできるだけ少量の濾過助剤用シリカゲルにより済ませたいという要望があり、濾過助剤用シリカゲルの吸着容量の一層の増量が望まれている。加えて、濾過速度を早くして被濾過物の製造サイクルの短縮化を図るべく、濾過助剤用シリカゲルを使用した際の濾過速度の一層の向上が望まれている。

【0010】本発明は、上述の要望に応えるべくなされたものである。すなわち。本発明の目的は、経時劣化が

-0.0705×(D_{max})-110.36>8 ・・・式(1)

[0013]

[0014]

[発明の実施の形態] 以下、本発明の一実施形態を詳細 に説明する。本発明の濾過助剤用シリカゲルは、酒類 (ビール、焼酎、味醂、清酒、果実酒など) のような発 酵飲料、発酵調味料(醤油、食酢など)、清凉飲料類 (ジュース(栗汁)、炭酸飲料など)、食用油類(ナタネ 油、ゴマ油、コーン油など)、各種医薬用原液、各種和 漢薬抽出液などを濾過して、製造過程で生じる不要物質 をこの被濾過物から除去するのを補助するものである。 【0015】つまり、被濾過物に本濾過助剤用シリカゲ ルを混入してから、これを譲材にフィードしたり、予め 遂材に本濾過助剤用シリカゲルをブレコートして、この 適材に上記被濾透物をフィードしたりすることにより、 コロイド状物質やたんぱく質等の不溶物質が上記濾過助 剤用シリカゲルと一体に上記被濾過物から分離・除去さ れることとなる。また、濾過助剤により吸着できないよ うな比較的サイズの大きな不要物質は減材により分離・ 除去される。

【0016】以下、本議過助剤用シリカゲルについて説明すると、本発明の譲過助剤用シリカゲルは、総孔容積及び比表面積が通常のものより大きい範囲にあることを特徴とする。異体的に、細孔容積の値は、通常0.6~2.0m1/gの範囲、好ましくは0.8~1.6m1/gの範囲に、また、比表面積の値は、通常300~1

少なく、生産性の向上、より選択的且つ効率的な不要物 質の吸着を実現できるようにした、濾過助剤用シリカゲ ルを提供することにある。

[1100]

【課題を解決するための手段】そこで、本発明者らは、 上記の課題を解決すべく鋭意検討した結果、高比表面積 かつ高細孔容積を有し、高純度かつ構造的な歪みの少な い均質で安定な構造であり、さらに細孔分布がシャープ な濾過助剤用シリカゲルを製造することに成功し、これ が上記要望に効果的に応えることを見出して、本発明を 完成させた。

【0012】すなわち、本発明の要旨は、被滅過物に接触させ該被濾過物中の不要物質を吸着したのち該不要物質と一体に該被濾過物から濾過により除去される、濾過助剤用シリカゲルであって。(a)細孔容積が0.6~2.0m1/gであり、(b)比表面積が300~100m2/gであり、(c)細孔の最頻度径(D_{max})が20m未満であり、(d)度径がD_{max}±20%の範囲内にある細孔の総容積が全細孔の総容積の50%以上であり、(e)非晶質であり、(f)金属不純物の総含有率が500ppm以下であり、(g)関体SI-NMRでのQ4ピークのケミカルシフトを3(ppm)とした場合に3が下記式(!)を満足することにある。

000m²/gの範囲、好ましくは300~900m²/gの範囲、更に好ましくは400~900m²/gの範囲に存在する。これらの細孔容積及び比表面積の値は、 窒素ガス吸脱者によるBET法で測定される。

【0017】また、本発明の濾過助剤用シリカゲルは、 細孔の最頻遠径〈D_{max}〉が20nm未満であることを 特徴とする。最頻遠径〈D_{max}〉は、気体や液体の吸着 や吸着に関する特性であり。最頻遠径〈D_{max}〉が小さ いほど吸着や吸着性能が高い。従って、穏々の特性の中 で最頻適径〈D_{max}〉は、特に吸着剤(濾過助剤)とし て使用する本シリカゲルにとって重要な物性である。本 発明の濾過助剤用シリカゲルの最頻遠径〈D_{max}〉は、 除去対象となる物質のサイズにより適宜選択され、特に 制限はないが、例えば発酵飲料の濾過助剤として混濁因 子となるアミノ酸やタンパク質を除去する場合、好まし くは4nm~18nm、さらに好ましくは5nm~15 nmである。

【0018】なお、上記の最頻度径(D_{max})は、窒素 ガス吸脱着によるBET法で測定した等温脱着曲線か ら、E. P. Barrett, L. G. Joyner、P. H. Haklenda. J. Amer. Chem. Soc., vol. 73, 373 (1981) に記載の BJH法により算出される細孔分布曲線をプロットして 求められる。ここで、細孔分布曲線とは、微分細孔容 積、すなわち、細孔液径d(nm)に対する微分窒素ガ ス級着量(ΔV/Δ(logd))を含う。上記のV は、窒素ガス級着容積を表す。

【0019】更に、本発明の濾過助剤用シリカゲルは、上記の最頻度径(D_{max})の値を中心として±20%の範囲にある細孔の総容積が、全細孔の総容積の通常50%以上、好ましくは60%以上であることを特徴とする。このことは、本発明の濾過助剤用シリカゲルが有する細孔の遺径が、最頻度径(D_{max})付近の細孔で揃っていることを意味する。なお、上記の最頻度径

(D_{MRX})の値の±20%の範囲にある細孔の総容積について、特に上限は無いが、通常は全細孔の総容積の90%以下である。

【OO20】かかる特徴に関連して、本発明の濾過助剤 用シリカゲルは、上記の日JH法により算出された最頻 直径(D_{max})における微分細孔容積 $\Delta V/\Delta$ (Ioed)が、通常 $2\sim20mI/s$ 、特に $5\sim12mI/s$ であることが好ましい(なお、上式において、dは細孔 直径 (nm) であり、Vは窒素ガス吸着容積である)。 微分細孔容積 $\Delta V/\Delta$ (Iog d)が前記範囲に含まれ るものは、最頻度径(D_{max})の付近に揃っている細孔 の絶対量が極めて多いものと言える。

【〇〇21】加えて、本発明の濾過助剤用シリカゲルは、その三次天構造を見るに、非晶質であること、即ち、結晶性構造が認められないことを特徴とする。このことは、本発明の濾過助剤用シリカゲルを X 練回折で分析した場合に、結晶性ピークが実質的に認められないことを意味する。なお、本明細書において結晶質であるシリカゲルとは、 X 練回折パターンで6 オングストローム (A Units d-specing) を越えた位置に、少なくとも一つの結晶構造のピークを示すものを指す。このような結晶質のシリカゲルの例としては、有機テンブレートを用いて細孔を形成するミセルチンプレートシリカが挙げられる。本発明のような非結晶質のシリカゲルに較べて、極めて生産性に優れている。

【0022】また、本発明の濾過助剤用シリカゲルは、不純物の含有率が非常に低く、極めて高純度であることを特徴とする。異体的には、シリカゲル中に存在することでその物性に影響を与えることが知られている、アルカリ金銭、アルカリ土類金銭、周期表の3A族、4A族及び5A族並びに遷移金銭からなる群に属する金銭元素(金銭不純物)の合計の含有率が、通常500ppm以下、好ましくは100ppm以下、更に好ましくは50pm以下、数もくは100ppm以下。更に好ましくは50pm以下、数も好ましくは30ppm以下である。中でも、特にシリカゲルの物性に与える影響が大きい、ア

 $-0.0705 \times (D_{max}) - 110.36 > 8$

を満足する (即ち、きの値が上配式 (1) の左辺で表わされる値 (-0、0705× (0max) -110、3 8) よりも小さい (よりマイナス側に存在する)) ことを特徴とする。従来のシリカゲルでは、上記の04ビークのケミカルシフトの値 δ は、上記式 (1) の左辺に基

ルカリ金銭及びアルカリ土類金銭からなる群に幾する元素の総含有率が、通常100ppm以下、中でも50ppm以下、更には30ppm以下、特に10ppm以下であることが好ましい。このように不純物の影響が少ないことは、本発明の濾過助剤用シリカゲルが高い耐熱性や耐水性などの優れた性質を発現できる大きな要因の一つである。

【0023】更に、本発明の濾過助剤用シリカゲルは、 骨格を形成するシロキサン結合の結合角に歪みが少ない ことを特徴とする。ここで、シリカゲルの構造的な歪み は、固体SI-NMR測定におけるG⁴ビークのケミカ ルシフトの値によって表わすことができる。以下、シリ カゲルの構造的な歪みと、前記のQ⁴ビークのケミカル シフトの値との関連について、詳しく説明する。

【0024】本発明の濾過助剤用シリカゲルは非晶質ケイ酸の水和物であり、SiO2・nH2Oの示性式で表されるが、構造的には、Siの四面体の各項点にOが結合され、これらのOに更にSiが結合して、ネット状に広がった構造を有する。そして、Si-O-Si-O-の級り返し単位において、Oの一部が他の成員(例えば一H、一CH3など)で置接されているものもあり、一つのSiに注目した場合、下配式(A)に示す様に4個の一OSiを有するSi(Q4)や、下記式(B)に示す様に3個の一OSiを有するSi(Q3)等が存在する[下記式(A)及び(B)では、上記の四面体構造を無視し、Si-Oのネット構造を平面的に表わしている]。そして、固体Si-NMR型定において、上記の各Siに基づくピークは、順にQ4ピーク、Q3ピーク、・・と呼ばれる。

[0025]

[12]

【0026】本発明の濾過助剤用シリカゲルは、上記の Q4ピークのケミカルシフトをδ (ppm) とした場合 に、δが下記式(I)

110.36>8 ・・・式(1)

づいて計算した値よりも、一般に大きくなる(よりブラス側に存在する)。よって、本発明の譲退助剤用シリカゲルは、従来のシリカゲルに比べて、Q4ビークのケミカルシフトがより小さな値を有することになる。これは、本発明の譲退助剤用シリカゲルにおいて、Q4ビー

クのケミカルシフトがより高磁場に存在するということ に他ならず、ひいては、SIに対して2個の-OSIで 表される結合角がより均置であり、構造的な歪みがより 少ないことを意味している。

【0027】本発明の譲退助剤用シリカゲルにおいて、Q4ビークのケミカルシフトがは、上記式(1)の左辺(-0.0705×(D_{max})-110.36)に基づき算出される値よりも、好ましくは0.05%以上小さい値であり、更に好ましくは0.1%、特に好ましくは0.15%以上小さい値である。通常、シリカゲルのQ4ビークの幾小値は、-113ppmである。

【〇〇28】本発明の濾過助剤用シリカゲルは、優れた 耐熱性や耐水性等を有しおり、外部から負荷を受けても 物性変化しにくい。このような点と、上記の様な構造的 歪みの関係については、必ずしも明らかではないが、次 の様に推定される。すなわち、シリカゲルは大きさの異 なる球状粒子の集合体で構成されているが、上記の様な 構造的に歪みの少ない状態においては、球状粒子全体の ミクロ構造的な高度の均質性が維持されるので、その結 果、優れた耐熱性や耐水性等が発現されるものと考えら れる。なお、Q³以下のピークは、SI-Oのネット構 造の広がりに制限があるため、シリカゲルの構造的な歪 みが現れにくい。

 $\{0029\}$ 上記の特徴に関連して、本発明の濾過助剤 用シリカゲルは、関体SI-NMR測定による $0^4/0^3$ の値が、通常1、3以上、中でも1、5以上であることが好ましい。ここで、 $0^4/0^3$ の値とは、上述したシリカゲルの繰り返し単位の中で、-0S 1 が3 個結合したSI $\{0^3\}$ に対する-0S 1 が4 個結合したSI

(Q4)のモル比を意味する。一般に、この値が高い程、シリカゲルの熱安定性が高いことが知られており、ここから、本発明の濾過助剤用シリカゲルは、熱安定性に極めて優れていることが判る。これに対し、上述したミセルテンブレートシリカは、Q4/Q3の値が1.3を下回ることが多く熱安定性が低い。

【0030】なお、Q4ビークのケミカルシフト及びQ4 /Q3の優は、実施例の説明において後述する方法を用 いて圏体Si-NMR測定を行ない、その結果に蒸づい て算出することができる。また、測定データの解析(ピ 一ク位置の決定)は、例えば、ガウス関数を使用した波 形分離解析等により、各ビークを分割して抽出する方法 で行なう。

【0031】本発明の濾過助剤用シリカゲルは、従来の ゾルーゲル法とは異なり、シリコンアルコキシドを加水 分解する加水分解工程と共に得られたシリカヒドロゾル を縮合する縮合工程を経てシリカヒドロゲルを形成する 加水分解・縮合工程と、当該加水分解・縮合工程に引き 続き、シリカヒドロゲルを熟成することなく水熱処理することにより、所望の物性範囲のシリカゲルを得る物性 額節工程とを、ともに包含する方法で製造することがで きる.

【0032】本発明の濾過助剤用シリカゲルの原料とし て使用されるシリコンアルコキシドとしては、トリメト キシシラン、テトラメトキシシラン。ドリエトキシシラ ン、テトラエトキシシラン、テトラプロポキシシラン、 テトラプトキシシラン等の炭素数1~4の低級アルキル 基を有するトリまたはテトラアルコキシシラン或いはそ れらのオリゴマーが挙げられるが、好ましくはテトラメ トキシシラン、テトラエトキシシラン及びそれらのオリ ゴマーである。以上のシリコンアルコキシドは蒸留によ り容易に精製し得るので、高純度のシリカゲルの原料と して好適である。シリコンアルコキシド中のアルカリ金 **翼又はアルカリ土類金属に翼する不純物元素(金属不純** 物) の総含有量は、通常100ppm以下、中でも50 ppm以下、更には30ppm以下、特に10ppm以 下が好ましい。これらのいわば金属不純物の含有率は、 一般的なシリカゲル中の不純物含有率の測定法と同じ方 法で測定できる。

【0033】シリコンアルコキシドの加水分解は、シリ コンアルコキシド1モルに対して、通常2~20モル、 好ましくは3~10モル、特に好ましくは4~8モルの 水を用いて行なう。シリコンアルコキシドの加水分解に より、シリカのヒドロゲルとアルコールとが生成する。 この加水分解反応は、通常、室温から100℃程度であ るが、加圧下で液相を維持することで、より高い温度で 行なうことも可能である。また、加水分解時には必要に 応じて、水と相溶性のあるアルコール顕等の溶媒を添加 してもよい。異体的には、炭素数1~3の低級アルコー ル類、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、 アセトン、テトラヒドロフラン、メチルセロルブ、エチ ルセロルブ、メチルエチルケトン、その他の水と任意に 混合できる有機溶媒を任意に用いることができるが、中 でも強い酸性や塩基性を示さないものが、均一なシリカ ヒドロゲルを生成できる理由から好ましい。

【0034】これらの溶媒を使用しない場合、本発明の 濾過助剤用シリカゲルの製造のためには、特に加水分解 の際の機件速度が重要である。すなわち、シリコンアル コキシドと加水分解用の水は初期には分液しているた め、機件によりエマルジョン化し、反応を促進させる。 この際の機件速度は通常30 r p m 以上、好ましくは5 0 r p m 以上である。断かる条件を満足しない場合に は、本発明の濾過助剤用シリカゲルを得るのが困難にな る。なお、加水分解によりアルコールが生成して液が均 一液となり、発熱が収まった後には、均一なヒドロゲル を形成させるために機絆を停止することが好ましい。

【0035】結晶構造を有するシリカゲルは、水中熱安 定性に乏しくなる傾向にあり、ゲル中に細孔を形成する のに用いられる界面活性創等のテンプレートの存在下で シリコンアルコキシドを加水分解すると、ゲルは容易に 結晶構造を含むものとなる。従って、本発明において は、界面活性剝等のテンプレートの非存在下で、即ち、 これらがテンプレートとしての機能を発揮する程の量は 存在しない条件下で、加水分解を行なうことが好まし い。

【0036】反応時間は、反応液組成(シリコンアルコキシドの種類や、水とのモル比)並びに反応温度に依存し、ゲル化するまでの時間が異なるので、一概には規定されない。なお、反応系に触媒として、酸、アルカリ、塩類などを添加することで加水分解を促進させることができる。しかしながら、斯かる添加物の使用は、後述するように、生成したヒドロゲルの熱成を引き起こすことになるので、本発明の濾過助剤用シリカゲルの製造においてはあまり針ましくない。

【0037】上記のシリコンアルコキシドの加水分解反応では、シリコンアルコキシドが加水分解してシリケートが生成するが、引き続いて該シリケートの縮合反応が起こり、反応液の粘度が上昇し、最終的にゲル化してシリカヒドロゲルとなる。本発明の濾過助剤用シリカゲルを製造するためには、上記の加水分解により生成したシリカのヒドロゲルの硬さが上昇しないように、実質的に熟成することなく、適ちに水熱処理を行なうことが重要である。シリコンアルコキシドを加水分解すると、軟弱なシリカのヒドロゲルが生成するが、このヒドロゲルを安定した熟成、あるいは乾燥させ、更にこれに水熱処理を施し、最終的に細孔特性の制御されたシリカゲルとする従来の方法では、本発明で規定する物性範囲のシリカゲルを製造することができない。

【0038】上記にある、加水分解により生成したシリカのヒドロゲルを、実質的に熟成することなく、直ちに水熱処理を行なうということは、シリカのヒドロゲルが生成した直後の数弱な状態が維持されたままで、次の水熱処理に供するということを意味する。シリコンアルコキシドの加水分解反応系に酸、アルカリ、塩額等を添加すること。または該加水分解反応の温度を厳しくし過ぎることなどは、ヒドロゲルの熱成を進行させるため好ましくない。また、加水分解後の後処理における水洗、乾燥、放置などにおいて、必要以上に温度や時間をかけるべきではない。

【0039】ヒドロゲルの熟成状態は、ヒドロゲルの硬度を参考することにより異体的に確認することができ、ヒドロゲルの硬度と相関するパラメータである破壊応力が、通常6MPa以下、好ましくは3MPa以下、更に好ましくは2MPa以下の柔らかい状態のヒドロゲルを水熱処理することで、本発明で規定する物性範囲のシリカゲルを得ることができる。

【0040】この水熱処理の条件としては、水の状態が液体、気体のいずれでもよく、溶媒や他の気体によって希釈されていてもよいが、好ましくは液体の水が使われる。シリカのヒドロゲルに対して、通常0.1~10重量倍、好ましくは0.5~5重量倍、特に好ましくは1

~3 重量倍の水を加えてスラリー状とし、適常 4 0 ~ 2 5 0 ℃、好ましくは 5 0 ~ 2 0 0 ℃の温度で、適常 0 1 ~ 1 0 0 時間、好ましくは 1 ~ 1 0 時間実施される。 水熱処理に使用される水には低級アルコール類、メタノール、エタノール、プロパノールや、ジメチルホルムアミド (DMF) やジメチルスルホキシド (DMSO)。 その他の有機溶媒などが含まれてもよい。なお、加水分解反応の反応器を用い、続けて温度条件変更により水熱処理を行なうことも可能であるが、加水分解反応とその後の水熱処理とでは通常、最適条件が異なっているため、この方法で本発明の濾過助剤用シリカゲルを得ることは一般的に難しい。

【0041】以上の水熱処理条件において温度を高くすると、得られるシリカゲルの細孔径、細孔容積が大きくなる傾向がある。水熱処理温度としては、100~200℃の範囲であることが好ましい。また、処理時間とともに、得られるシリカゲルの比表面積は、一度極大に達した後、緩やかに減少する傾向がある。以上の傾向を踏まえて、所望の物性値に応じて条件を適宜選択する必要があるが、水熱処理は、シリカゲルの物性を変化させる目的なので、通常、前記の加水分解の反応条件より高温条件とすることが好ましい。

【0042】水熱処理の温度、時間を上記範囲外に設定すると、本発明の濾過助剤用シリカゲルを得ることが困難となる。例えば、水熱処理の温度が高すぎると、シリカゲルの細孔径、細孔容積が大きくなりすぎ、また、細孔分布も広がる。逆に、水熱処理の温度が促過ぎると、生成するシリカゲルは、架橋度が低く、熱安定性に乏しくなり、細孔分布にビークが発現しなくなったり、前途した固体SI-NMRにおけるQ4/Q3値が極端に小さくなったりする。

【0043】なお、水熱処理をアンモニア水中で行なうと、純水中で行なう場合よりも低温で同様の効果が得られる。また、アンモニア水中で水熱処理すると、純水中で処理する場合と比較して、最終的に得られるシリカゲルは一般に疎水性となるが、通常30~250℃、好ましくは40~200℃という比較的高温で水熱処理すると、特に疎水性が高くなる。ここでのアンモニア水のアンモニア激度としては、好ましくは0.001~10%、特に好ましくは0.005~5%である。

【0044】水熱処理されたシリカヒドロゲルは、通常40~200℃、好ましくは60~120℃で乾燥する。乾燥方法は特に限定されるものではなく、バッチ式でも連続式でもよく、且つ、常圧でも滅圧下でも乾燥することができる。必要に応じ、原料のシリコンアルコキシドに由来する炭素分が含まれている場合には、通常400~600℃で焼成除去することができる。また、表面状態をコントロールするため、最高900℃の温度で焼成することもある。

【0045】更に、得られた原料シリカゲルを必要に応

じて粉砕・分級して所定の粒径にすることで、最終的に 目的としていた本発明の濾過助剤用シリカゲルが得られ る。なお、シリカゲルの形状は緩定されず、球状であっ ても良いし、形の機定されないその他の塊状であっても 良いし、後述するように破砕して細かな形状 (破砕状) としても良いし、さらには、破砕状のものを集めて造粒 したものであっても良い。コスト的には、粒径の制御が 容易な破砕状又はこれを造粒したものが好ましい。

【0046】ここで、濾過助剤用シリカゲルの粒径は、 濾過速度、圧損、不要物質の吸着効率の観点から、通常 100μm以下である。好ましくは、50μm以下であ る。これは、一般的に、シリカゲルを粒径50μm以下 にすると、単位重量当たりの外表面積が増加し、且つ粒 界にも各種物質を吸着・吸収することが出来るようにな るため、吸着・吸収性能が更に高くなるからである。す なわち、本発明のシリカゲルの粒径を小さくすることに よって、本発明のシリカゲルが既に持つ高細孔容積、高 比表面積、シャープな細孔分布、高純度で物性変化が少 ない等の各種の特徴を発展させ、更に吸着・吸収性に優 れたシリカゲルとすることが出来るのである。

【0047】さらに、このような観点からシリカゲルの 粒径は、30μm以下に設定することがより好ましい。 また、シリカゲルの粒径は、小さすぎると被譲過物を譲 過する際の圧力抵抗が増大し譲過速度が低下してしまう ので1μm以上であることが好ましい。なお、シリカゲ ルの分級は、例えば篩、薫カ分級機、遠心分級機などを 使用して行なわれる。また、粉砕は、以下のようにして 行なわれる。

【0048】原料シリカゲルを粉砕する方法としては、 公知のいかなる装置・器異を用いても良い。例えば、ボ 一ルミル(転動ミル、振動ポールミル、遊星ミル等)、 機律ミル(塔式粉砕器、機拌樽型ミル、流通管型ミル、 アニュラー(環状)ミル等)、高速回転微粉砕機(スク リーンミル、ターボ型ミル、遠心分級型ミル)、ジェッ ト粉砕機(循環ジェットミル、衝突タイプミル、流動層 ジェットミル〉、せん断ミル(榴解機、オングミル)、 コロイドミル、乳鉢などの装置・器具を用いることがで きる。これらの中で、シリカゲルを比較的の小さな径 〈例えば2 um以下〉とする場合には、ボールミル、攪 拌さルがより好ましい。また、粉砕時の状態としては、 湿式法及び乾式法があり、何れも選択可であるが、シリ カゲルを比較的の小さな怪とする場合には湿式法がより 好ましい。覆式法の場合、使用する分散媒としては、水 及びアルコール等の有機溶媒の何れを用いても、また2 種以上の混合溶媒としても良く、目的に応じて使い分け る。また、湿式法の場合には、次に造粒を行なうのであ ればその前に、必要に応じて乾燥を行なうことがある。 微粉砕時に不必要に強い圧力や剪断力を長時間かけ続け ることは、原料シリカゲルの細孔特性を損なうことがあ り好ましくない。

【0049】なお、上述したように、粉砕されたシリカ ゲル粒子(一次粒子)を公知の方法により造粒し、粒状 〈例えば球状〉の凝集体の形状としてもよい。シリカゲ ルは一般に一次粒子径2μm以下の場合、特にバインダ 一を添加しなくても水スラリーとしてこれを乾燥するだ けで凝集粒子を得ることができるが、20mを越える粒 子の場合、凝集させるためにはパインダーが必要である ことが多い。パインダーとして用いることができる物質 は何れのものでも良いが、例えば水に溶解する場合は砂 糖、デキストローズ、コーンシロップ。ゼラチン、カル ボキシメチルセルロース (CMC)、ボリビニルアルコ ール(PVA)、その他の水溶性高分子、水ガラス、シ リコンアルコキシド加水分解液(これは溶媒系にも使用 可)などを用いることができ、溶媒に溶解して用いる場 合には各種ワックス、ラッカー、シラック、油溶性高分 子等を用いることができる。原料シリカゲルの多孔質性 能を損なわずに凝集体とするためには、バインダーを使 用しないことが望ましく、やむを得ず使用する場合には 最低限の使用量とし、原料シリカゲルの物性変化を誘起 したり、食品加工上不適当であったりするような金蹊不 純物量の少ない高純度なものを用いることが好ましい。 【〇〇5〇】シリカゲル微粒子を造粒する方法は公知の

【0051】本発明の一実施形態としての濾過助剤用シリカゲルは上述したように形成されるので以下のような利点がある。つまり、本濾過助剤用シリカゲルは、直径がDmax±20%の範囲内にある細孔の総容積が、全細孔の総容積の50%以上であり、従来の濾過助剤用シリカゲルに較べ細孔分布が狭い〔細孔の直径が、幾頻直径(Dmax)付近の細孔で揃っている〕。加水分解反応後の水熱処理温度を調整することにより細孔径を変更することが可能であり、本濾過助剤用シリカゲルの細孔分布がこのように狭いということは、細孔径を高精度に制御可能であるとともに、細孔径を微妙に変更することが可能であることを意味する。

【〇〇52】そして、被濾過物質中の混濁因子となる所定のタンパク質やコロイド成分(不要物質)のサイズに応じて、細孔径を上記のような高精度且つ激細な細孔径制御を行なうことにより、所望の不要物質を精度良く識別して選択的に除去することができ、これにより、被濾過物が特に発酵飲料のような嗜好品である場合に被濾過物の風味や香味や色度を極めて繊細に顕整できるようになるという利点がある。

【0053】また、有機テンプレートを使用しないの

で、上述したような高精度に細孔径の制御されたシリカゲルを比較的低コストで製造できるという利点もある。また、本濾過助剤用シリカゲルは、微分細孔容積 Δ V / Δ 〈 I o g d 〉が、通常 2 ~ 2 O m I / g であり、これは、最頻適径 (Omax) の付近で直径が揃っている細孔の絶対盤が極めて多いことを示し、所望の不要物質を効率的に除去できるようになるという利点がある。

【0054】さらに本発明のシリカゲルは開程度の細孔 径を有する従来シリカゲルと比較して比較的高比表面積 かつ高細孔容積という特徴を有するため、濾過速度と吸 引性能との両性能においてに優れており、被濾過物の濾 過時間の短縮ひいては製品の生産性の向上を実現でき、 加えて、被濾過物の不溶物質を少量で効率的に吸着でき るという利点がある。

【0055】また、本線過助剤用シリカゲルは、その細孔の最頻直径(Dmax)が20mm未満であり、吸着性能が高く、比較的少量使用するだけで、被線過物質より不要物質を除去できるという利点がある。さらに、本線過助剤用シリカゲルは非結晶質であることから極めて生産性に優れているという利点がある。

【0058】加えて、本発明の濾過助剤用シリカゲルは、不純物の含有率が非常に低く。さらに、上式(1)を満たして構造的な歪みがより少ないことから、耐水性や耐熱性等に優れており、被濾過物に長時間混合されたり、或いは焼成等による再生処理(被濾過物から吸着した不要物質を除去して再び不要物質を吸着しうる状態にすること)が繰り返されたりしても、安定して上記性能を発揮できるという利点がある。

[0057]

【実施例】以下、本発明を実施例により、更に詳細に説明するが、本発明はその要旨を超えない限り、以下の実

施例に制約されるものではない。

(1) シリカゲルの分析方法

1-1)細孔容積、比表面積

カンタクローム社製AS-1にてBET窒素吸着等温線 を測定し、細孔容積、比表面積を求めた。具体的には細 孔容積は相対圧P/P0=0.98のときの値を採用 し、比表面積はP/P0=0.1.0.2,0.3の3 点の窒素吸着盤よりBET多点法を用いて算出した。また、BJH法で細孔分布曲線及び最頻度径(Dmax)に おける做分細孔容積を求めた。測定する相対圧の各点の 間隔は0.025とした。

【0058】1~2)粉末X線照折

理学電機社製RAD-R日装置を用い、CoKのを線源 として測定を行った。発散スリット1/2deg、散乱 スリット1/2deg、受光スリットO、15mmとし た。

1-3) 金屋不純物の含有量

試料2.5gにフッ酸を加えて加熱し、乾漉させたのち、水を加えて50mlとした。この水溶液を用いて1 CP発光分析を行った。なお、ナトリウム及びカリウム はフレーム炎光法で分析した。

【0059】1-4)圏体S(-NMR測定 Bruker社製圏体NMR装置(「MSL300」) を使用するとともに、共略圏波数59、2MHz(7、 05テスラ)、7mmのサンブルチューブを使用し、C P/MAS(Cross Polarization / Magic Angle Spinn ing)プローブの条件で測定した。異体的な測定条件を 下の表1に示す。

[0060]

(表 1)

选1 閣体Si-NMRの測定条件

XNOE KX	5000rps		
スペクトル幅	29000Hz		
データーボイント	4096		
OppmØ 3 .*	テトラメチルシランを使用		
2次基準(-9. 55ppm)	ヘキサメテルシクロトリシロキサンを使用		
繰り返し時間	40085		
プロードニングファクター	100Hz(なお、フーリエ変接時にローレン ツ陽敷を使用した)		
****	25°C		
プロトンのデカップル強度	SOkHz		

【0061】測定データの解析(G4ビーク位置の決定)は、ビーク分割によって各ビークを抽出する方法で行なう。異体的には、ガウス関数を使用した波形分離解析を行なう。この解析には、サーモガラテック(Thermogaletic)社製の波形処理ソフト「GRAMS386」を使用することが出来る。

(2) シリカゲルの製造、評価

実施例1~3

ガラス製で、上部に大気開放の水冷コンデンサが取り付けてあるちしセパラブルフラスコ(ジャケット付き)

に、純水1000gを仕込んだ。100 rpmで撹拌しながら、これにテトラメトキシシラン1400gを3分間かけて仕込んだ。水/テトラメトキシシランのモル比は約6である。セパラブルフラスコのジャケットには50℃の温水を透水した。引き続き撹拌を継続し、内容物が沸点に到速した時点で、撹拌を停止した。引き続き約0、5時間、ジャケットに50℃の温水を透水して生成したゾルをゲル化させた。その後、速やかにゲルを取り出し、目開き600ミクロンのナイロン製網を通してゲルを粉砕し、粉体状のウェットゲル(シリカヒドロゲルを粉砕し、粉体状のウェットゲル(シリカヒドロゲ

ル)を得た。このヒドロゲル450gと純水450gを 1 Lのガラス製オートクレープに仕込み、実施例1につ いては130℃×3Hr、実施例2については150℃ ×3Hr、実施例3については200℃×3Hrの条件 で、それぞれ水熱処理を実施した。所定時間水熱処理し た後、No、5A濾紙で濾過し、得られたシリカゲルを 水洗することなく100℃で恒量となるまで減圧乾燥し て、それぞれ実施例1~3の原料シリカゲルを得た。 鉢にて粉砕後、篩により分級し、平均粒径15μmの粉体(実施例1~3のシリカゲル)を得た。これらの実施例1~3のシリカゲルの諸物性を下記の表2及び表3に赤す。表2及び表3には、併せて、市販のビール濾過助剤用シリカゲルであるシオノギ製薬(株)製のカーブレックスBS-304(参考例1),BS-306(参考例2)の諸物性を参考例として示す。

[0063]

【0062】をして、各原料シリカゲルを、それぞれ乳 【表2】

表2 シリカゲルの諸物性ー3

200 m a 200 c c v m 200 due (com					
	突施粥:	寒路粥2	赛騰辦3	***	***
最級資程D _{max} (mm)	\$.8	8.9	13.3	8,1	18.0
D _{mes} における能分 解孔容積(mi/g)	8	11	11	\$	ŷ
沈養邀獲《m²/※》	842	213	419	418	828
総報孔容機(ml/g)	0.89	1,33	1.60	1.10	1.16
D _{ma} 士20%の範囲内の 第孔の容積比(%)	63	71	78	88	58
@ ₄ \@ ₂	1.7	2.3	8.8	2.8	3.7
金属不能物の含有率 (ppm)	8.5	9.5	8.8	711	773

[0064]

【表3】 表3シリカゲルの諸権性一2

	Dass (nm)	0°E50 +5<4.00 (mag)	(_{***} G) × 80°0,3- - 38.611 (maa)
寒遊湖:	3.9	~111,17	-115.64
28%%	6.9	~111.35	-110.85
突換領3	13.8	~111.66	-111.80
\$ ***	8.1	-110.90	11D,98
* ******	13.0	-111.12	-111.28

【0065】本議過助利用シリカゲルの実施例1~3は、養2に示すように、最頻度径(Dmax)の値を中心として±20%の範囲にある細孔の総容積が、いずれも全細孔の総容積の60%以上と高く、シャーブな細孔分布を有している。例えば、実施例3の本シリカゲルと、参考例2のシリカゲルとは最頻度径Dmaxが路間じであるが、度径がDmax±20%の範囲内にある細孔の総容積が、参考例2では全細孔の総容積の68%に対し実施例3では78%と高い。つまり、本発明の議過助利用シリカゲルは、参考例2のような従来の議過助利用シリカゲルは、参考例2のような従来の議過助利用シリカゲルに較べ、水熱処理温度を調整することによりその細孔径をきめ細かに制御できるのである。

と参考例2のシリカゲルとを、比義面積及び総細孔容積 について見比べてみると、明らかに実施例3の本シリカ ゲルの方が大きく、参考例2のような従来のシリカゲル に較べ、被濾過物の濾過時間の短縮ひいては製品の生産 性の向上を実現でき、加えて、被濾過物の不溶物質を少 量で効率的に吸着できる。

【0067】また、本護過助剤用シリカゲルの各実施例 1~3は、ナトリウム含有率が0.2ppm、カリウム含有率が0.2ppmであり、その他の金属は検出されなかった。つまり、本 渡過助剤用シリカゲルの各実施例 1~3のトータルの不 純物金属含有率は、それぞれ、養 2に示すように0.5ppmであり、参考例 1、2と較べても。析遂いに純度が高く。耐熱性・耐水性などに優れている。また、このように純度が高いということは、食品の濾過助剤として使用される場合に衛生上の観点から極めて高い後位点といえる。

【0068】さらに、数3に示すように、本濾過助剤用シリカゲルの各実施例1~3では、園体Si-NMRのQ4ピークのケミカルシフトの値は上式(I)により計算される値よりも小さい(よりマイナス側にある)。これに対し、参考例1、2のような従来のシリカゲルでは、園体Si-NMRのQ4ピークのケミカルシフトの値は上式(I)により計算される値よりも大きい(よりプラス側にある)。これは、本濾過助剤用シリカゲルの各実施例1~3は、参考例1、2のような従来のシリカゲルに較べて構造的なひずみが少ないことを意味し、過酷な使用条件(例えば長期間にわたり被濾過物中におかれたり、再生を目的とした機成を繰り返されたりするような条件)においても物性が変化しにくい(即ち劣化しにくい)ことを示す。

(3) 譲退助剤用シリカゲルの性能評価

本濾過助剤用シリカゲルは、上述したように、従来シリカゲルと同様に、ビール、焼酎、味醂、清酒、果実酒などの酒類や、醤油、食酢等の発酵網味料や。ジュース(果汁)、炭酸飲料などの清涼飲料類や、ナタネ油、ゴマ油、コーン油等の食用油類や、各種医薬用原液や、各種和淡薬抽出液などの濾過助剤として使用される。

【0069】濾過助剤としての性能評価項目としては、 例えば濾過速度や、タンパク質吸着能力や、滤過による 各種製品の安定化効果等がある。異体的な例として、ビ 一ルの濾過助剤として使用する場合の性能評価項目の代 表的な例とその評価方法とを以下に示す。

①濁度試験

議過したビールを強制的に劣化させ、その濁度を目視或 いはヘイズメータにて測定し、初期(議過直後)の濁度 と比較してビール中のコロイド成分やタンパク質が会合 又は凝集して混濁していく度合いを調べるものである。 議過による混濁因子(不要物質)の除去が不十分である と徐々に透明度が下がり、特に低温保存時に強い混濁を 生じる。これらの混濁因子吸蓄能力に優れるシリカゲル を譲過助剤とするとビールの保存安定性が向上する。

[0070] 異体的には、例えば以下のような条件の濁 度を測定し、比較する。

<当日濁度>濾過塩後のビールの濁度を目視或いはヘイズメータにて測定。

<50℃独制劣化濁度〉:濾過液後のビールを瓶詰め
し、50℃で1週間程度保存した後、このビールの濁度
をヘイズメータにて測定。
</p>

<50℃強制劣化後の寒冷混濁濁度>:上記の50℃で保存した後のビールを更に24時間0℃の恒温水槽に入れて寒冷混濁を析出させた後、0℃の状態のままビールの混濁を目視或いはヘイズメータにて測定。

②混凝医子级兼試験

ビール中に含まれる混濁図子或分を抽出し、これを5% エタノール溶液に加えて溶解させ、同時にこの溶液のp Hをビールのp Hに合わせる。そして、この溶液にシリ カゲルを一定量添加し、一定時間撹拌した後でこの溶液 を濾過する。試験前後の溶液の混濁因子成分濃度の変化 からシリカゲルの吸着量を求める。混濁因子であるミオ グロビンなどのタンパク質や、ポリフェノールなどのコ ロイド成分に関してこのような試験を行なうことによ り、シリカゲルの混濁因子を吸着除去する能力を知るこ とが出来る。直接ビールを用いて試験をずると、より実 際的なデータ(シリカゲルの吸着除去性能)を得ること が出来る。

(DSASPL值(飽和硫安決殿限界)

シリカゲルにより濾過を行なったビールに飽和碗安アン モニウムを一定量ずつ滴下していき、タンパク質の不溶 化による濁度の上昇曲線から沈殿服界量を求める。この 値が大きいほど混濁因子成分の量が少なく混濁が起こり にくいことになる(即ちシリカゲルの吸着除去性能が高 いことになる)。

【0071】異体的には、50m1(ミリリットル)のガス抜きしたビール試料を撹拌しながら、このビール試料に飽和硫安溶液を滴下し、660nmの波長の光をビール試料にあててこの光の透過率を測定することによりビール試料の濁度を連続的に観察する。そして、ビール試料の濁度が急減に増加し始めたら、その時点までの飽和硫安溶液滴下量をSASPし値とする(Jams,

S. Hough, MBAA Technical Quartely, 13, 34 (1976) 参照)。

のその他の特性

ビールの濾過により、混濁因子となる成分(不要物質) を除去する事は重要であるが、ビールには同時に除去す べきではない成分(ビールの色度、泡持ち、香味に関連 する成分)も存在する。このため、上記不要物質をこの ような必要な成分と区別して吸着除去できるか否かが、 濾過助剤用シリカゲルの優秀を判定する上での大きな項 目となる。つまり、シリカゲルを使用した濾過後のビー ルの色度や泡持ち時間や香味等を上記の試験とともに評 価することにより、濾過助剤としてのシリカゲルの総合 的な評価を行なうことができる。

⑤減過速度

譲過速度が低いと、ビール原料を譲材に通すのに時間が 掛かりビールの生産性が低くなるため、生産性の観点か も、該過速度はシリカゲルの性能を評価する上で重要な ファクターとなる。なお、濾過速度は、濾過助剤用シリ カゲルの粒径や細孔容積に左右されるため、粒子強度の 弱いシリカゲルを使用すると、経時的な構造的劣化によ り粒径や細孔容積が変化してしまい、ビール原料を達材 に通す際の差圧が上昇し、濾過速度が低下する度があ る。したがって、強制的に負荷(例えば熱負荷)をかけ てから濾過速度を測定するなど、劣化を考慮した濾過速 度をシリカゲルの性能評価項目として測定することも考 えられる。

[0072]

【発明の効果】本発明の濾過助利用シリカゲルによれば、細孔分布がシャーブであり、その細孔径を従来よりも精度良く制御することが可能である。したがって、混 濁因子となる被濾過物中のタンパク質やコロイド成分等の不要物質のサイズに合わせて細孔径を微妙に制御し幾 適化することが可能であり、これにより所望の成分をより選択的に吸着し除去することが可能となる。したがって、被濾過物が、食品、特に発酵飲料(例えばビール)のような嗜好品であれば、風味や色度や香味に影響を与える各種成分やタンパク質を選択的に被 海域物に残存させ)、独特の風味、色度、香味を持つ製品を得ることが可能となる。

【0073】また、本発明の濾過助剤用シリカゲルによれば、ごく微量の不純物を含有するだけなので、食品の

濾過に好適である。また、本発明の濾過助剤用シリカゲルは、このように高純度であるとともに、構造的な歪みの少ない均質で安定な構造であるため、過酷な使用条件においても物性変化が少ない特徴を有する。従って、長時間にわたる使用、或いは焼成等の再生工程を伴う繰り返し使用時において吸着特性や濾過特性の劣化が少ないという利点がある。

【0074】さらに本発明のシリカゲルは同程度の細孔 怪を有する従来シリカゲルと比較して比較的高比表面積 かつ高細孔容積という特徴を有するため、滤過速度と吸 引性能との両性能において優れており、被濾過物の濾過 時間の短縮ひいては製品の生産性の向上を実現でき、加 えて、被濾過物の不溶物質を少量で効率的に吸着できる という利点がある。

フロントページの続き

Fターム(参考) 48028 AC12 AG04 AP17 AS04

40066 CA01 0812

49066 AAZZE AB18A BA09 BA20 BA24 BA25 BA33 BA38 EA11 FA05

49072 AA28 BBOS BB13 CC10 DD03 DD04 GG01 HH30 RROS TT01 TT08 TT09 TT19 TT30 UU27